90kG 超 電 導 マ グ ネ ッ ト

90 kG Superconducting Magnet

相 山 義 道*	木 村 浩**	工 藤 実 弘**
Yoshimichi Aiyama	Mitsuhiro Kudô	
多田直文*** Naofumi Tada	斎 藤 龍 生**** Ryusei Saitô	

要 旨

高磁界用超電導合金として開発したZ合金ならびにS合金線の確性試験として80kGパンケーキ形コイルを 試作した。このコイルは外層,内層二つのコイルから成り,外層はX合金(Nb-40 Zr-10 Ti)を用いた HISU-PER-10 X ストリップ,内層はZ合金(Nb-62.5 Ti-2.5 Zr)を用いた HISUPER-16 ZMB ストリップで巻かれ ており,あわせて79kGの中心磁界を得た。またS合金(Nb-59 Ti-1 Si)を用いた小形ソレノイドをこのコ イルの中にそう入し,三つの組合せコイルで92kGの中心磁界を得た。これらの実験の結果,高磁界用超電導 合金としてのZならびにS合金は高磁界発生コイル用線材としてじゅうぶん使用できることが確認された。

1. 緒 言

日立における超電導材料およびマグネットの開発研究は通産省大型プロジェクトを一つの大きな目標として進んできた。その成果は日立の開発したX合金すなわちNb-40Zr-10Ti合金を用いた委託研究45kG 鞍(くら)形超電導マグネットの実験成功という形で実った⁽¹⁾。しかし今後,超電導マグネットが各種の分野で実用されるためにはより高い磁界を発生できることが要求される。日立ではこの要求に対処するため高磁界用超電導合金の研究を進め,X合金と同じNb-Ti-Zr3元合金ではあるが,Nb-Ti 側の組成を有するZ合金, すなわちNb-62.5Ti-2.5Zr 合金の開発を行なった⁽²⁾。さらに電子技術総合研究所との共同研究によってSiを含む新合金,Nb-59Ti-1Siの組成を持つS合金を開発した⁽³⁾。本報告はこれら高磁界用超 電導合金として開発したZならびにS合金の確性試験ならびに高電流密度の高磁界マグネットの開発を目的として試作した80kGおよび90kG⁽⁴⁾マグネットについてまとめたものである。



この種の合金系材料を用いた高磁界超電導マグネットの研究は, 国外では Westinghouse 社の Coffey 氏らの 100 kG ソレノイド⁽⁵⁾, Ferranti-Packerd 社の Atherton 氏らの 102 kG ソレノイド⁽⁶⁾があ る。また国内では三菱電機株式会社岩本氏らの 75 kG パンケーキ形 コイル⁽⁷⁾, 日本大学安河内氏の 79 kG (1.5°K では 105 kG) ソレノ イド⁽⁸⁾がある。

2. コイルの設計

コイルの基本設計方針を次のように決めた。

(1) コイル全体を第Ⅰブロック(内層),第Ⅱブロック(中間層), 第Ⅲブロック(外層)に3分割する。第Ⅱ,第Ⅲブロックでそれぞれ約40kGを発生させ80kGとし,第Ⅰブロックで10kGを発生させ80kGとし,第Ⅰブロックで10kGを発生させ,合計90kGとする。

(2) 第Ⅲブロックでは性能的にも製作的にも安定している HI SUPER-10 X ストリップ⁽⁹⁾(委託研究 45 kG 鞍形マグネット用に
 開発したもの)を用いる。

(3) 第IIブロックでは高磁界用線材Z合金のメタラジカルボン



図1 HISUPER-10Xストリップに対する2種の絶縁方式

表1コイルの設計仕様

				第Ⅲ ブロック	第Ⅱブロック	第Iブロック
7	内	径	(mm)	340	80	20
イル	外	径	(mm)	550	300	65
「法	長	5	(mm)	356	356	100
中心	心磁束	密度	(kG)	40	80	90
電	流 彩	量	(A)	1,000A at 40 kOe	300A at 80 kOe	8 A at 90 kOe
ス	~ -	- ++		3mm ギャップ	なし	ta l
				HISUPER-10X	HISUPER-16 ZMB	HISUPER-1S
線	組	成	(at%)	Nb-40 Zr-10 Ti	Nb-60Ti-5Zr	Nb-59Ti-1Si
	4.	法	(mm)	7 w×1.6 t ($0.25\phi \times 10$ 本)	2.3 ϕ (0.26 ϕ ×16本)	$0.37\phi imes 0.25\phi$
	Cu	/Supe	r 比	20:1	4:1	1:1
材	絶	緑		スパイラル (7 w×0.2t テープ)	スパイラル (0.4t×3wテープ)	22 µt (ポリイミド)
	全	長	(km)	3	3	2
重		量	(kg)	370	140	

(4) 高電流密度でマグネットを運転するには液体ヘリウムと接 する線材の冷却面積をできるだけ広くする必要があり、従来のフ ラット絶縁方式の代わりにスパイラル絶縁方式を用いた(図1参 照)。そして、第Ⅱブロックには冷却通路を設けるためにスペー サをそう入しない。
(5) 第Ⅰブロックは高磁界用線材S合金を用いて巻いた小形ソ レノイドとする。
以上の方針で設計したコイルおよび線材の仕様は表1に示すとお りである。

1

ド線材を用い,	高電流密度化をねらって銅と超電導線との断面積
比を小さくする	0

* 電子技術総合研究所理学博士
** 日立製作所中央研究所
*** 日立製作所日立研究所
**** 日立製作所日立工場

524日 評 論 17.

VOL. 53 NO. 6 1971









線材1SのH-IcおよびC.S.特性



図3 第Ⅰ,第Ⅱ,第Ⅲの三つの ブロックコイル

3. 超電導線材

第Ⅲブロックコイルに用いたHISUPER-10Xストリップの通電電 流容量ならびに安定性についてはすでに報告している(9)のでここで は省略する。第Ⅱブロックコイル用につくった HISUPER-16 ZMB は 2.3 mm 径の銅の中に 0.26 mm 径の Z 合金が 16 本メタラジカル・ ボンド加工法によって埋め込まれたものであり,銅と超電導線の断 面積比は約4対1である。この線材の界面抵抗(10)は0.004 μΩ-cm² と非常に小さく銅と超電導線との密着性が良いことを示し、またそ の磁界-臨界電流 ($H-I_c$) 曲線は図2(a) に示したとおりで80 kG の Ic が 400 A であった。第 I ブロックコイル用の HISUPER-1S は 0.25 mm 径のS合金線に 58 µ厚さの銅クラッド後, 22 µ厚さのポリ イミド絶縁被覆をした外径 0.41 mm 径の単心複合線である。 図2 (b)はこの線を2ターンの小コイルとして測定した H-Ic 曲線を示 したものであるが、H→I(磁界一定・電流増加)の操作およびコイ ル・シミュレーション(磁界と電流とを同時に増加)の操作におけ

 $\mathbf{2}$

図5 組み上がった90kGコイルをクライオスタットに そう入するところ

る Ic が一致し、少なくとも 30 kOe 以上の磁界ではコイル特性の劣 化(Degradation)は見られないことが推定された。

4. コイルおよびクライオスタット

試作したコイルの寸法はほぼ設計どおりである。その外観は図3 に示すとおりである。第Ⅲブロックはいわゆるダブル・パンケーキ 巻きで54 ターン34 層から成り,各層間のスペースは3mmで,スペ ーサとして15mm幅, 3mm厚さのものを15度おきにそう入して いる。第Ⅱブロックにはスペーサを入れず,通常のソレノイドと同 様の巻き方をした。したがってこのコイルのクーリング・チャンネ ルはスパイラル絶縁した円形断面の線のすき間であり、絶縁テープ の厚み0.4mmが最小値となる。第Iブロックはコイル自体小さな もので quench (常電導転移) しても特に問題はないと考え,通常の 物性研究用ソレノイドと同じ方法で巻いた。 クライオスタットとしては液体ヘリウム槽(そう)内径65cm,深 さ125 cm のものを製作した。クライオスタット関係のフローシー トは図4に示すとおりである。図5は組み上がったコイルをクライ オスタットの上ぶたに取り付けたところを撮影したものである。

525 90kG 超電導マグネット



۲

0





(b) 6SEG. コイル

図7 40kGコイル(第IIブロック)のコイル電流 Iと 常電導部の発生により生じた電圧 VN の時間変化

200 r



(c) 第1, 第II ブロックコイルの分割励磁回路



(d) 第0ブロックコイルの分割励磁回路

12-	ャン	ト 抵 打	$t器: Sh_1(100 \text{ mV}/1,000 \text{ A}), Sh_2, Sh_3(100 \text{ mV}/2,000 \text{ A}), \$
			$Sh_4(10 \text{ mV}/50 \text{ A})$
直	流	電	源:PS1 (20V 2,000 A), PS2 (20V 1,000 A), PS3 (10V 100 A)
小	部	抵	抗: $R_{D1}(0.25\Omega)$, $R_{D2}(2.5\Omega)$, $R_{D3}(0.20\Omega)$, $R_{D4}(10\Omega)/$

励 磁 回 路 図 6

で励磁を続けたところ、1,258A で急激な電圧の上昇が見られコイ はダブルパンケーキ巻きで2層) すなわち34層から成る。 これを ルは quench した。このときの線材の最大経験磁界は 37 kG であっ 6 SEG. と 11 SEG. に分けてそれぞれ単独に励磁することができる た。図7(b)は、このときの $I \ge V_N$ の時間変化を示したもので、 ようにした。電圧端子は各 SEG.の端子電圧が測定できるようにし, 常電動部が初めて発生したのは1,200Aであった。 また中心磁界および最大経験磁界が測定できるようにホール素子を 図8は17 SEG.ならびに6 SEG.の励磁実験結果をIとVNでま コイルの中心および第9SEG.の内側に取り付けた。 励磁回路は図 とめたものである。常電導部が初めて発生する電流値 Ic' は HISU-6(a), (b)に示すとおりである。 PER-10Xストリップの Ic に近い値を示した。 最初は17SEG.コイルについて励磁回路(a)により40A/minの上 5.2 80 kG コイル(第Ⅱ, 第Ⅲブロック)の励磁 昇速度で900Aまで励磁した。900Aまで異常なく励磁できたので, 一つの電源で第Ⅱ, 第Ⅲブロックの二つのコイルを励磁するため いったん電流をゼロに戻し、次は100A/minの上昇速度で900A



図8 40 kG コイル (第 II ブロック)の V_N -I 曲線

まで励磁し, その後は40A/min で励磁を続けた。940A付近で常電 導部分が発生したが,電流上昇を止めると端子電圧は一定値を保ち, 常電導部分の伝播(でんぱ)は見られなかった。 さらに 10A/min の 低速度で励磁を続けると端子電圧の上昇するのがはっきりわかっ た。973Aで励磁を止めたが、そのときの中心磁界 Boは 39.5 kG, 線材の最大経験磁界は45kGであった。図7(a)はこの励磁実験に おける電流 I と端子電圧Vの時間変化を示したものである。端子電 圧はコイルのインダクタンスLによるもの

$$V_s = L \frac{di}{dt}$$

と、常電導部分が発生したときに現われる常電導電圧 VN の和で記 録されたが、図7(a)ではこの VNのみを示した。

3

次に17 SEG.のコイルの中の上側の6 SEG.のみを励磁した。ゼ ロから1,000Aまでは100A/min で励磁し、1,000A でいったん電流 を停止して常電導部分の発生のないことを確かめたのち,40A/min 5. 励磁 実験 の速度で励磁した。電流が1,235Aに達したときにわずかではある 5.1 40 kG コイル (第 III ブロック)の励磁 が常電導部の発生が見られたので、これを確認するため10A/min 第Ⅲブロックコイルは合計17SEG. (セグメント)(1セグメント

526

日 立 評 論

50 r 40 (**A**) コイル電流 30 1 20 10 第I 10 20 4060 100

HISUPER-1Sのコイル特性(第 I ブロック) 図 9

に図6(c)に示すような分割励磁回路を用いて第Ⅲブロックコイル に流れる電流と第Ⅱブロックに流れる電流の比が5対4になるよう にした。 まず100A/minの励磁速度で上昇し, 第Ⅲブロックコイ ルの電流が300,400,450,500Aのときに電流の増加を一時停止し, 各コイルの端子電圧に異常のないことを確かめた。第Ⅲブロックコ イルの電流が500Aのとき、第IIブロックコイルの電流は380Aで 組合せたコイルの中心磁界は79kGであり、設計の80kGがほぼ 満足された。 このときの第Ⅱブロックコイルの電流は380Aであっ たので、HISUPER-16 ZMB のコイル特性としては短尺試料の I_c 値近くまで安定に電流を流しうることが確認された。

VOL. 53 NO. 6 1971

90 kG 超電導マグネットの特性 表 2

	第Iブロック	第Ⅱ ブロック	第Ⅲ ブロック
超電導線材	S 合 金 (Nb-59Ti-1Si) 単 線 ポリイミド絶縁	Z 合 金 (Nb-62.5Ti-2.5Zr) 銅丸線に16本埋込み メタラジカルボンド 方式 スパイラル絶縁	X 合 金 (Nb-40Zr-10Ti) 銅ストリップに10本 埋込み 圧延方式 スパイラル絶縁
有効空間内径(cm)	1.5	7	32
コイル内径 (cm)	2	8	34
コイル外径 (cm)	6.5	30	55
コイル長 (cm)	10	36	35
コイル電流 (A)	9	380	500
磁界係数 (G/A)	1,435	154	43
各ブロック 発生磁界 (kG)	13	58	21
総合中心磁界(kG)		92	





5.3 90 kG コイル(第Ⅰ, 第Ⅱ, 第Ⅲブロック組合せ)の励磁 三つのブロックの組合せ励磁は第Ⅱ, 第Ⅲの80kGコイルの励磁 と同時に行なわれた。すなわち第Iブロックコイルの電源としては 別に一つ用意して、80kGコイルの第Ⅲブロックのコイル電流が 400,415,450,500A(第Ⅱブロックコイルの電流はそれぞれ320, 332, 360, 400A)のときに一時電流を停止した状態で, 第 I ブロッ クコイルの電流を図6(d)の励磁回路により、3.3A/minの励磁速 度で quench するまで上昇した。 第 I ブロックコイルが quench し ても第Ⅱ, 第Ⅲブロックコイルの端子電圧に異常は認められなかっ た。第Ⅲブロックコイルの電流が415,450,500Aのときの第Ⅱ, 第Ⅲブロックコイルの発生した磁界はそれぞれ 65.5,71,79 kG に 相当し、これが第 I ブロックコイルのバイアス磁界となる。この関 係は図9にまとめて示されている。なお、図9には第 I ブロックの 単独励磁の場合を示してあるが、トレーニング効果なしで39Aま で励磁でき、そのときの磁界は56kGであった。この単独ならびに 組合せ励磁で第 I ブロックが quench したときのコイル電流と短尺 試料の H-Ic 特性はよい一致をみた。 組合せ励磁のなかで, 79 kG のバイアス磁界では9Aで13kGの磁界を発生し、三つのコイルを 合わせると92kGとなった。この92kGコイルの特性は表2および 図10に示すとおりである。 このことから HISUPER-1S は高磁界 用線材としてじゅうぶん使用できることが確認された。

6. 結果の検討

6.1 コイル特性

4

40 kG パンケーキコイル(第Ⅲブロック)を単独励磁したときの中 心磁界は39.5 kG で40 kG より若干下回った。しかしこのときの線 材の最大経験磁界は45kGであったのに対して、第Ⅱブロックコイ



のような意味で40kGコイルは安定化されているといえる。このコ イルの熱流束 qm を安定化パラメータの式を用いて計算してみると

$$\alpha = \frac{\left(\frac{\rho}{A}\right)I^2}{q_m\,\beta P_0} \quad \dots \qquad (1)$$

ここでαは安定化パラメータ,ρは銅の磁気抵抗効果を含めた比抵 抗, Aは銅の断面積, Poはストリップの全周囲, Bは露出係数(5)で ある。従来, コイルの qm は最大電流 Im を(1)式の I に入れ, α=1 として求めていた。しかし、コイルの V-I (電圧-電流) 特性は短尺 試料の V-I 特性とは異なり、後者では Ic 以上の電流が流れたとき に発生する電圧の大きさは抵抗状態における銅への電流の分流の大 きさによるが,前者,すなわちコイルの V-I 特性における Ic' 以上の 電流による電圧の発生は, 主として常電導部分の伝播によるもので ある⁽¹¹⁾。したがって α=1とするよりは,むしろ Lontai⁽¹²⁾の常電導 部分が伝播するかしないかという条件, すなわちコイルが quench したときの電流 Im と α=2を用いるべきであると考えた。この考え 方で求めたコイルの q_m は6SEG. で0.24 W/cm², $q_m\beta$ で表わすと 0.10 W/cm² であった。17 SEG. では quench しなかったが, 973A を入れて求めると、 $q_m \ge 0.17 \text{ W/cm}^2$ 、 $q_m \beta \ge 0.07 \text{ W/cm}^2$ となった。 また, 尾形研究員らのクーリング・チャンネルによる qm の実験結 果(13)をもとにして,チャンネル幅3mm,長さ2mmの上向きなら びに下向き面およびチャンネル幅 0.2 mm, チャンネル長さ7 mmの 垂直面のqからコイルのqmを求めてみると,

ルと組み合わせると最大経験磁界は約41kGまで下がることが計算 で求められているので40kGをじゅうぶん満足することがほぼ確実 であり,特にこれを確かめるための実験は行なわなかった。また電 流が940Aに達してもコイルが quench することなく,さらに電流を 増加し,一部常電導部分を発生させ電圧が出た状態で電流を保持し ても,常電導部分がさらに伝播することなく安定に励磁された。こ







言 7. 結

高磁界,高電流密度の超電導マグネット用線材として開発した2 合金 (Nb-62.5 Ti-2.5 Zr) ならびにS合金 (Nb-59 Ti-1 Si) の確性 試験を目的に試作した80kGおよび90kG超電導マグネットの励磁 実験を行なった結果,下記の結論を得た。

(1) 第Ⅲブロック(外層)をHISUPER-10Xストリップ,第 Ⅱブロック(内層)をHISUPER-16 ZMB線材で巻き、これら二 つのコイルを組合せて79kGの中心磁界を発生した。またHI-SUPER-1Sを巻いたソレノイド(第Iブロック)を上記コイルの 内側にそう入し、三つのコイルを組合せて最高92kGの中心磁界 を得た。

(2) スパイラル絶縁を施して冷却面積を広くした HISUPER-10X ストリップを用いた第Ⅲブロックコイルは、ある程度安定性 を確保して,なおかつ高電流密度化した状態でもストリップの短 尺試料の H-Ic 特性まで励磁できることがわかった。コイル全断 面での平均電流密度で比較すると、従来のフラット絶縁10Xス トリップで巻いたパンケーキコイルの1.3倍に達した。 スパイラ ル絶縁方式はパンケーキ形コイルの高電流密度化に有効である。 (3) スパイラル絶縁 HISUPER-16 ZMB で巻き, スペーサを 用いず高磁界で高電流密度化を図った第Ⅱブロックコイルの平均 電流密度は79kGで4.2×10³ A/cm²であった。またこのコイルは HISUPER-16 ZMBの短尺試料の Ic 値まで安全に運転される。 またZ合金は60~80kGの高磁界でじゅうぶんな性能を有して いる。

となった。 この値は先に求めた値 0.24 W/cm² とよく一致して いる。

第Ⅱブロックコイルは quench あるいは常電導部分の発生が認め られなかったために qm を求めることはできないが、79kG で 380A の値を用いて形式的に計算すると、 qm は 0.30 W/cm² 以上, qm β で は 0.12 W/cm² 以上であることが推定された。中形のコイルでは円 形断面の線材に厚目のテープでスパイラル絶縁をすれば、特別にク ーリング・チャンネルを設けなくても線材のIc近くまで安定に励 磁できるものと思われ、高電流密度コイルの製作の可能性を高めた ものといえる。

Z合金線の臨界電流密度をHISUPER-16ZMBの短尺試料のH-Ic 特性より求めると, 80 kOe で 5.3×10⁴ A/cm² の値であった。S 合金の臨界電流密度は80 kOe で 3.7×10⁴ A/cm² と低かったのは、 第1回の長尺試作線のため,最適熱処理,加工条件とも少し異なる 加工方法を採用したためであり、当然、より高い Jc 値すなわち 6.2 ×10⁴ A/cm^{2⁽³⁾に近い値の線をつくることができると考えられる。}

6.2 コイルの平均電流密度

図11は今までに日立製作所で実験した各種超電導コイルの平均 電流密度を比較したものである。本実験に用いたスパイラル絶縁ス トリップで巻いたパンケーキコイル(第Ⅲブロック)の平均電流密 度は図中⑤で示され、6SEG.の場合を⑤6,17SEG.の場合を⑤17, で表わしてある。従来のフラット絶縁ストリップによって巻かれた コイル②のそれと比較して1.3倍程度高く、高電流密度コイルの製 作の可能性を高めたものといえる。また, 第Ⅱブロックコイルの平 均電流密度は79kGで約4.2×10³ A/cm² であり、図中⑥に位置す る。これはスパイラル絶縁線材を用いたうえに、 クーリング・チャ ンネルを設けるためのスペーサも省略したためである。スパイラル 絶縁ストリップを用い,スペーサを省略する高電流密度化の方式は, 少なくとも中形の高磁界発生用パンケーキ形コイルあるいはソレノ イドに有効であるといえる。

(4) 種々のバイアス磁界のもとで励磁した第 I ブロックコイル の特性から, S合金はコイル特性にも不安定性がみられず, コイ ルにして用いたときの HISUPER-1Sの電流容量は, 短尺試料の H-Ic 特性と一致した。 S合金は 60~90 kG 発生の高磁界物性研 究用小形ソレノイド用線材に適している。

本研究を行なうにあたり,電子技術総合研究所富山技官,日立製 作所日立研究所飯塚主任研究員,日立工場笠原副技師長,加沢主任 技師,中央研究所土井部長,石田研究員には有益なご討論をいただ いた。また線材の製作では日立電線株式会社の関係者にご協力いた だき、中央研究所黒田主任研究員にはコイルの設計を手伝っていた だいた。そのほか,佐藤主任研究員,尾形研究員にはクライオスタ ットの製作について有益なご助言をいただいた。以上のかたがたに 感謝の意を表する次第である。

文 献 考 参

- (1) 木村ほか: 低温工学 5, (2), p.69 (1970)
- T. Doi, et al: Trans. AIME 242, p. 1793 (1968) (2)
- 石田ほか: 低温工学 5, (3), p.157 (1970) (3)
- 相山ほか: 低温工学研究発表会 第6回 30a-S-5 (4)
- H. T. Coffey, et al: J. Appl. Phys. 36, p. 128 (1965) (5)
- D.L. Atherton, et al: Canadian J. Appl. Phys. 48, p. (6)1003 (1970)
- 岩本ほか: 低温工学 5, (2), p.44 (1970) (7)
- 安河内: 日本工業新聞 (45.6.30) (8)
- 土井ほか: Proc. of the First ICEC, Kyoto (1967) (9)
- 工藤ほか: 低温工学 4, (5), p. 213 (1969) (10)
- 工藤ほか: 低温工学研究発表会 第6回 30a-S-6 (11)
- L. Lontai: ANL Report No. 7192 (1966-3) (12)

尾形ほか: International Institute of Refrigeration, Com-(13)mission I Meeting, Tokyo (1970) T. Doi, et al: Proc. of the Second ICEC, Brighton, Eng-(14)land (1968)

5